초전도기술 산업화지원센터 설립

한국전기연구원 운영 … 2005년까지 정부예산 60억원 투입

산업자원부는 2000년 6월부터 2002년 6월까지 2년간 정부지원금 12억원과 민간부담금 7억원 등 19억원을 투입해 한국전기연구원에 설립한 「초전도기술 산업화지원센터」를 통해 기업의 초전도기술산업화 지원을 개시했다.

초전도기술 산업화지원센터는 2005년까지 정부예산 60억원과 민간기업 부담금 25억원 등 5억원이 투입될 예정이다.

초전도기술 산업화지원센터는 정부의 산업기술기반조성사업의 일환으로 설립됐으며, 초전도기술 개발에 절대적으로 필요하고 민간기업이 개별적으로 구입하기 어려운 고가의 차세대 대구경 초전도 마그네트 기반설비와 초전도 도제 평가설비 등을 구축하는 사업으로 한국전기연구원(총괄책임자 성기철 박사)은 초전도기술 산업화지원센터를 통해 관련기업에 대한 기술지원을 적극 수행하게 된다.

2005년부터 단기에 기술개발이 가능한 일부 초전도기술 상용화가 가능할 것으로 보고 있는데 고성능 초전도 실리콘 단결정 성장장치, 차세대 초전도 자기분리 장치, 차세대 고자장 자기공명영상장치(MRI), 고분해능 핵자기공명 분광기(NMR) 개발을 추진하고, 중장기 계획수립을 통한 초전도 전문 벤처기업 설립도 지원해 초전도 전력응용기기, 초전도 산업응용기기도 개발할 방침이다.

정부와 한국전기연구원은 초전도기술 산업화지원센터를 통해 연구장비와 설비의 산·학·연 공동 활용 및 협동연구 체제구축을 지원하게 됨으로써 초전도분야의 핵심기술을 조기에 확보할 수 있고, 개발한 기술을 적기에 상용화할 수 있도록 효율적으로 민간기업에 기술을 이전해줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 2010년경에는 일부 주요 초전도기술을 상용화함으로써 5000명 정도의 신규고용 창출과 연간 6000억원 정도에 달하는 초전도제품의 수출도 가능할 것으로 전망하고 있다.

<Chemical Daily News 2002/08/05>